Becmuk

# МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

№ 4-1976

УДК 537.5

≣⊘∽

#### А. Ф. АЛЕКСАНДРОВ, С. А. РЕШЕТНЯК

### К ТЕОРИИ СИЛЬНОТОЧНЫХ РАЗРЯДОВ С ОБРАТНЫМ ТОКОМ

Проанализирована область существования сильноточного самосжатого разряда с обратным током в оптически непрозрачной и оптически «серой» (полупрозрачной) плазме и найдена связь основных параметров плазмы с внешними параметрами полным числом частиц в разряде и силой разрядного тока. На основе полученных соотношений проведен количественный анализ применительно к типичным условиям эксперимента.

Экспериментальные исследования линейных самосжатых разрядов в плотной плазме, проведенные в последнее время (например [1-6]), показали высокую излучательную способность таких разрядов и убедительно подтвердили правильность развитой для них теории [1, 2, 7-10]. Эти исследования показали, в частности, что в полном соответствии с теорией линейные разряды в оптически прозрачной или «серой» плазме подвержены силовым неустойчивостям типа перетяжек и изгибов [4], а разряды в оптически прозрачной плазме — еще и перегревной неустойчивости [6].

Развитие неустойчивостей делает структуру разряда сильно неоднородной и вследствие этого ухудшает его качества как источника излучения, не говоря уже об резком уменьшении его времени жизни. В этой связи представляется актуальным дальнейший анализ так называемых обратных пинчей или разрядов с обратным током в оптически плотной плазме, обладающих гораздо большей устойчивостью, чем обычные линейные или прямые пинчи. Этот анализ должен в первую очередь касаться установления связи необходимых параметров разряда (температуры и характерных размеров плазмы) с внешними параметрами (исходное полное число, частиц в разряде, сила разрядного тока), а также исследования разряда с обратным током в оптически «серой» или, точнее, полупрозрачной плазме и установления области его существования. В данной статье и излагаются некоторые результаты такого анализа.

#### Исходные уравнения

Анализ разряда с обратным током в плотной плазме проведен на основе обычной системы уравнений магнитной гидродинамики с учетом потока излучения для полностью ионизированной идеальной плазмы [7—9]. Нас интересуют в основном равновесные стационарные характеристики разряда. В силу того, что сведения об устойчивости рассматриваемых разрядов получаются тривиальным обобщением результатов анализа непрозрачного разряда ([7—9]), эту систему можно записать в цилиндрической системе координат в следующем виде:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rB) = \frac{4\pi}{cM} j = \frac{4\pi}{c} \sigma E,$$
  
$$\frac{\partial P}{\partial r} + \frac{1}{4\pi r} B \frac{\partial}{\partial r} (rB) = 0,$$
  
$$P = \frac{(1+z)k}{M} \rho T = (1+z)kNT; \quad \sigma = \frac{\alpha}{z} T^{3/2}, \quad (1)$$
  
$$\alpha = 4 \cdot 10^7, \quad \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma} = q_s(N, T),$$

где соответствующие величины относятся к равновесному стационарному (v=0) состоянию разряда. Здесь  $\sigma$  — проводимость плазмы,  $\rho$  — плотность, M — масса ионов, а z — их средний заряд, остальные обозначения общеприняты. Излучательную способность плазмы  $q_s$ , как н в [9], определим следующим образом:

$$q_{\rm s} = \operatorname{div} \mathbf{S}_1 + \operatorname{div} \mathbf{S}_2,$$

где  $S_1$  — поток излучения длинноволновых квантов с частотами  $v < v_0$ , для которых среда полностью непрозрачна, а  $S_2$  — поток излучения коротковолновых квантов, для которых среда прозрачна. Граничная частота  $v_0$  выбирается, как и в [9], из условия равенства единице оптической толщины разряда т:

$$\mathbf{r} = \mathbf{x}_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}_0) \, \mathbf{x}_e, \tag{2}$$

где  $\varkappa_v(v_0)$  — спектральный коэффициент поглощения с учетом переизлучения, а  $x_e$  — равновесная толщина плазменного слоя.

Рассмотрим случаи чисто тормозного поглощения и поглощения многократно ионизованными атомами. В первом случае можно записать точное выражение для  $\varkappa_{v}$  [11]:

$$\mathbf{x}_{v} = \frac{4, 1 \cdot 10^{-23} \, z^{3} N^{2}}{T^{7/2}} \cdot \frac{1 - \exp\left(-x\right)}{x^{3}}; \quad \left(x = \frac{hv}{\lfloor kT}\right), \tag{3}$$

При этом для  $S_1$  и  $S_2$  согласно [9] получим:

$$S_{1} = \int_{0}^{v_{0}} S_{v} dv = -\frac{4\pi}{3} \frac{kT}{h} \int_{0}^{x_{0}} \frac{\nabla I_{ve}}{\kappa_{v}'} dx = -\beta_{0} \frac{T^{13/2} f(x_{0})}{N^{2} z^{3}} \nabla T,$$
  

$$div S_{z} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rS_{2}) = \int_{v_{0}}^{\infty} dv \int d\Omega \kappa_{v}' I_{ve} =$$
  

$$= \gamma_{0} N^{2} \sqrt{T} z^{3} \exp(-x_{0}),$$
  

$$I_{ve} = \frac{2 (kT)^{3} x^{3}}{c^{3} h^{3} (\exp(x) - 1)};$$
(4)

$$f(x_0) = \int_0^{x_0} \frac{\exp(2x) x^2}{[\exp(x) - 1]^3} dx,$$

$$\beta_0 = 2.8 \cdot 10^{17}; \quad \gamma_0 = 1.4 \cdot 10^{-27}.$$

Для случая многократно ионизованных атомов выражение для  $\varkappa_{v}$  имеет сложный вид [11], поэтому будем приближенно описывать зависимость  $\varkappa_{v}$ . Для  $v < v_{0}$  мы будем пользоваться выражением

$$\varkappa_{v} = \frac{2 \cdot 10^{-23} z (1+z)^{2} N^{2}}{T^{7/2}} \frac{\exp(x) - 1}{x^{3}}, \qquad (5)$$
$$(x < x_{0}),$$

которое получается для многократно июнизованных атомов в приближении Крамерса — Унзольда, а для  $v > v_0$  используем выражение для чисто тормозного поглощения (3), но с другим коэффициентом, определяемым требованием непрерывности  $\varkappa_v$  при  $v = v_0$ . Тогда выражение (3) перепишется так:

$$\varkappa_{v} = \frac{2 \cdot 10^{-23} \exp\left(-x_{0}\right) z \left(1+z\right)^{2} N^{2}}{T^{7/2}} \frac{1-\exp\left(-x\right)}{x^{3}}.$$
 (6)

Использовать выражение (5) и в области  $x > x_0$ , как легко видеть, нельзя, так как при этом выражение для div  $S_2$ , расходится. С помощью выражений (5) и (6) нетрудно получить

$$S_{1} = -\frac{\beta_{1} T^{13/2} f_{1}(x_{0})}{N^{2} z (1+z)^{3}} \nabla T;$$

$$f_{1} = \int_{0}^{x_{0}} \frac{x^{2} \exp(x)}{[\exp(x)-1]^{3}} dx,$$
(7)
div  $S_{2} = \gamma_{1} N^{2} \sqrt{T} z (1+z)^{2}, \quad \beta_{1} = 6,15 \cdot 10^{17},$ 

$$y = 7 \cdot 10^{-28}.$$

#### Равновесие разряда с обратным током в оптически непрозрачной плазме

Рассмотрим сначала некоторые характерные особенности обратного пинча в оптически непрозрачной плазме. Предел непрозрачного разряда соответствует  $v_0 \rightarrow \infty$  и  $S_2 \rightarrow 0$ . Такой разряд рассмотрен в [7], где получены общие выражения для распределения основных величин в разряде. Нетрудно показать, что в случае квазиплоского разряда ( $r=R_0+x$ ,  $|x| \ll R_0$ , где  $R_0$  — средний радиус плазменной оболочки (см. рис.)) все характеризующие разряд величины могут быть достаточно просто выражены через величину полного разряданого тока *I*, полного числа частиц на единицу длины разряда  $N_n$  и радиус  $R_0$ .

$$B(x) = \frac{4\pi}{c} \sigma E = \sqrt{8\pi P(0)} \frac{x}{x_e},$$
  

$$P(x) = P(0) \left(1 - \frac{x^2}{x_e^2}\right), \quad \rho(x) = \rho(0) \left(1 - \frac{x^2}{x_e^2}\right).$$

(8)

а температура практически однородна т. е.

$$T(x) = T(0) = \frac{I^2}{3(1+z) kc^2 N_n} \frac{x_2}{R_0}.$$
 (9)

Здесь P(0),  $\rho(0)$  и N(0) — эначения соответствующих величин в центре плазменного слоя, т. е. при  $r = R_0$  или x = 0. Далее

$$T(0) = \frac{1}{(8\pi^2 \, 3kc^2 \, a\sigma^*)^{2/13}} \left[ \frac{z}{(1+z) \, N_n} \right]^{2/13} \frac{I^{8/13}}{R_0^{6/13}} \simeq$$

$$\simeq 2 \cdot 10^{-2} \left( \frac{z}{1+z} \right)^{2/13} \frac{I^{8/13}}{N_n^{2/13} R_0^{6/13}} . \qquad (10)$$

$$x_e = \left( \frac{z}{8\pi^2 a\sigma^*} \right)^{2/13} [3 \, (1+z) \, kc^2 \, N_n]^{11/13} \frac{R^{7/13}}{I^{18/13}} \simeq$$

$$\simeq 7, 9 \cdot 10^3 \frac{z^{2/13} \, (1+z)^{11/13} \, R^{7/13} \overline{N_n^{11/13}}}{I^{18/13}} , \qquad (11)$$

$$N(0) = \frac{(6a\sigma^*)^{2/13} \, N_n^{2/13}}{[8kc^2 \, (1+z)]^{11/13} \, \pi^{9/13} \, z^{2/13}} \frac{I^{18/13}}{R_0^{20/13}} \simeq$$

$$\simeq 1,5 \cdot 10^{-5} \frac{I^{16/13} N_n^{2/13}}{z^{2/13} (1+z)^{11/13} R_0^{20/13}},$$
 (12)

где о\* — постоянная Стефана — Больцмана.

гле

Для удобства дальнейшего изложения мы ввели индекс нуль для обозначения соответствующих величин в непрозрачном разряде. При получении этих выражений считаем, что излучение выходит только с внешней поверхности плазменной оболочки, а не с обеих поверхностей, как указано в [7], поскольку на эксперименте либо совсем не поглощается излучение внутри плазменной полости, либо сам разряд помещается внутрь цилиндрического отражателя. Случай, при котором излучение уходит с обеих поверхностей, получается путем простой замены в формулах постоянной о\* на 20\*.

Отметим далее, что из требования  $x_e \ll R_0$  автоматически следует классическое соотношение для токов в стационарном равновесном обратном пинче  $2I_0 = I$ .

Область применимости соотношений (8)—(12) определяется, с одной стороны, требованием малости расселандова пробега по сравнению с толщиной слоя плазмы  $l_R \ll x_e$ , а с другой — требованием малости характерного размера изменения плотности плазмы по сравнению с характерным масштабом неоднородности температуры  $x_e^2 \ll x_T^2$ . Эти требования накладывают следующие ограничения на силу разрядного тока:

$$1, 1 \cdot 10^{-31} \Phi > I > 6 \cdot 10^{-33} \Phi$$

$$4,6 \cdot 10^{-30} \Phi_1 > I > 2,9 \cdot 10^{-31} \Phi_1$$

(13)

$$\mathbf{D} = \frac{z^3}{(1+z)^{4/10}} \frac{N_n^{22/10}}{R_n^{12/10}}$$

469

( $\Phi$ —для тормозного поглощения и  $\Phi_1$ —поглощения многократно ионизованными атомами). При нарушении левого неравенства плазма в разряде становится оптически прозрачной, а при нарушении правого температура в разряде должна стать столь же неоднородной, как и плотность. Наконец, для того, чтобы разряд стал квазиплоским, т. е. для того, чтобы выполнялось неравенство  $R_0 \gg x_e$ , полный разрядный ток должен быть достаточно большим:

 $\Phi_1 = z^{4/10} (1+z)^{22/10} \frac{N_n^{22/10}}{R_n^{12/10}}$ 

$$I > 1,5 \cdot 10^2 \frac{z^{2/18} (1+z)^{11/18} N_a^{11/18}}{R_0^{6/18}}$$

Приведенные соотношения, показывают, что разряд с обратным током существенно отличается от обычного линейного пинча. Это отличие заключается в более слабой зависимости температуры и характерной толщины разряда от внешних параметров — силы разрядного тока и полного числа частиц в разряде. Как следует из (9) и (11), в разряде с обратным током

$$T \sim I^{18/13} N_n^{-2/13}$$
 и  $x_e \sim N_n^{11/13} I^{-18/13}$ 

в то время как в линейном пинче

$$T \sim I^2 N_n^{-1}$$
 и  $r_e \sim I^{-3} N_n^{11/6}$ .

Кроме того, параметры разряда с обратным током существеннейшим образом зависят от его радиуса  $R_0$ . Интересно заметить, что переход от непрозрачнохо к прозрачному разряду происходит при увеличении полного тока, а переход к разряду с сильно неоднородной температурой — при уменьщении фазрядного тока, в то время как в линейном пинче дело обстоит как раз наоборот. Такое поведение разряда объясняется зависимостью оптической толщины разряда от силы разряда объясняется действительно, в разряде с обратным током  $\tau \sim x_e/l_R \sim I^{-10/13}$ , т. е. падает с увеличение I, в то время как в линейном пинче  $\tau \sim I^2$ , т. е. сильно растет с ростом сильноразрядного тока. Более слабая по сравнению с Z-пинчем зависимость  $\tau$  от I объясняет также значительное расширение области применимости (13) выражений (10) — (12).

## Равновесие разряда с обратным током в оптической позупрозрачной плазме

Рассмотрим более общий случай оптически серой плазмы. Анализ разряда с обратным током в оптически серой плазме проводится совершенно аналогично тому, как это сделано в [9] для случая линейного пинча. Так, при условии однородности температуры в разряде из первых двух уравнений системы (1) легко находится распределение давления, плотности и магнитного поля, которое полностью совпадает с (8).

Распределение температуры по оси разряда получается подстановкой распределений (8) и выражений (4) или (7) для случаев тормозного излучения или излучения многократно ионизованными атомами в уравнение баланса энергии системы (1). При этом получаем

$$T_{0}(x) = T_{0}(0) \left[ 1 + \frac{B}{2C} \frac{x^{2}}{x_{e}^{2}} \left( 1 - \frac{4}{3} \frac{x^{2}}{x_{e}^{2}} + \frac{38}{45} \frac{x^{4}}{x_{e}^{4}} - \frac{1}{6} \frac{x^{6}}{x_{e}^{6}} + \frac{11}{25} \frac{x^{8}}{x_{e}^{8}} \right) - \frac{A}{2C} \frac{x^{2}}{x_{e}^{2}} \left( 1 - \frac{x^{2}}{x_{e}^{2}} + \frac{1}{3} \frac{x^{4}}{x_{e}^{4}} \right) \right],$$

где

$$A = \sigma(0) E^{2} = \frac{P(0) c^{2}}{2\pi\sigma x_{e}^{2}},$$

$$B = \gamma_0 N_m^2 \sqrt{T(0)} z^3 \exp(-x_0),$$
  

$$C = \frac{\beta_0 T(0)^{15/2} f_1(x_0)}{z^3 N_m^2 x_c^2} = \frac{\beta_0 T^{15/2} f(x_0) R_0^2}{z^3 N_n^2} \left(\frac{8\pi}{3}\right)^2$$

для случая тормозного механизма излучения. Для случая излучения многократно ионизованными атомами в этих формулах следует заменить  $\beta_0$  и  $\gamma_0$  на  $\beta_1$  и  $\gamma_1$ . Отсюда следует условие применимости использованного приближения однородности температуры:

$$A \ll 2C; \quad B \ll 2C.$$
 (15)

Толщина плазменного слоя определяется как обычно из условия баланса энергии на поверхности разряда:

$$S(r_e) = -\frac{j_0^2}{\sigma_0} 2x_e. \tag{16}$$

Поток  $S(r_e)$  с внешней поверхности плазменного слоя вычисляется из уравнения переноса излучения при требовании зеркального отражения на внутренней поверхности. Расчет, аналогичный проведенному в [9] и [11], дает

$$S(r_2) = \sigma^* T_0^4(0) \xi_1(x_0),$$
  

$$\xi_1(x_0) = \frac{32}{\pi^4} \frac{x_0^3}{\exp(x_0) - 1} + \frac{15}{\pi^4} \int_0^{x_0} \frac{x^3 dx}{\exp(x) - 1}$$
(17)

для случаев тормозного механизма излучения и излучения многократно ионизованными атомами. Тогда из (16) с учетом (17) и выражения для температуры (9) находим

$$x_{e} = \frac{x_{e0}}{[\xi_{1}(x_{0})]^{2/3}},$$
  
$$T(0) = \frac{T_{0}(0)}{[\xi_{1}(x_{0})]^{2/13}}$$

и далее

$$N(0) = N_0(0) \, [\xi_1(x_0)]^{2/13}$$

Наконец, чтобы полностью определить все величины, нужно найти  $x_0$  из уравнения (8), которое может быть записано в виде

$$1,25 \left(\delta \xi_{1}\right)^{13/10} \left(\frac{1-\exp\left(-x_{0}\right)}{x_{0}^{3}}\right)^{13/10} \Phi = I, \qquad (18)$$

471

где  $\delta$  — численный множитель в выражениях для коэффициента поглощения, равный  $\delta_0 \approx 4,1\cdot 10^{-23}$  для тормозного поглощения и  $\delta_1 \approx 2\cdot 10^{-23}$ для поглощения многократно ионизованными атомами (см. (3) и (5)), а  $\Phi$  (z,  $R_0$ ,  $N_n$ ) определяется формулой (14). Это уравнение легко решается графически.

Проанализируем область применимости полученных выражений. Так же, как и в случае нелинейного пинча в серой плазме [9], эта область определяется неравенствами (15), обеспечивающими однородность температуры в разряде. Рассмотрим случай тормозного поглощения. При этом первое неравенство (15) может быть записано следующим образом:

$$\xi_{1}(x_{0}) \ll \frac{4\beta_{0}\delta_{0}}{\alpha^{*}} \frac{1 - \exp(x_{0})}{x_{0}^{3}} f(x_{0}) = F_{0}(x_{0}) \simeq 0.81 \frac{1 - \exp(x_{0})}{x_{0}^{3}} f(x_{0}).$$

Графики функций  $\xi_1(x_0)$  и  $F_0(x_0)$ представлены на рис. Видно, что это неравенство выполняется при значениях  $x_0$ , удовлетворяющих неравенству

$$2.5 \simeq x_{0 \min} < x_0 < x_{0 \max} \simeq 15.5.$$

Второе неравенство (15) принимает вид

$$1,2\Psi(x_0)\ll F_0(x_0)$$



и, как видно из рис., не накладывает новых ограничений на область возможных значений  $x_0$ . Подставляя найденные значения  $x_{0 \text{ mbn}}$  и  $x_{0 \text{ max}}$ в уравнение (18), найдем область изменения силы разрядного тока в сером разряде

$$1,9 \cdot 10^{-31} \Phi > I > 6 \cdot 10^{-34} \Phi.$$
 (19)

Сравнивая неравенство (19) и первое из неравенств (13), видим, что в сером разряде верхняя граница силы разрядного тока увеличилась примерно в пять раз, т. е. несколько больше, чем это было в линейном пинче. Однако коэффициент преобразования излучения вблизи границы прозрачности увеличился в сером разряде с обратным током по сравнению с непрозрачным всего в [ $\xi_1 (x_{0 \text{ min}})$ ]<sup>-1</sup>  $\simeq$  1,1.

Нетрудно показать, что в случае излучения многократно ионизованными атомами в сером разряде верхняя граница разрядного тока также увеличивается примерно в пять раз при слабом увеличении коэффициента преобразования излучения.

#### . Обсуждение полученных результатов

Как следует из приведенного анализа разряда с обратным током, зависимость его характеристик от внешних параметров существенно иная, чем в линейном Z-пинче. Это в первую очередь касается предельных токов, величина которых существенно зависит от числа частиц в разряде и раднуса обратного пинча в отличие от линейных разрядов, в которых предельные токи являются универсальными константами, зависящими лишь от характера излучения. При этом в противоположность линейному разряду обратный непрозрачный, или серый пинч реализуется при токах, меньших максимального предельного значения. Кроме того, для разряда с обратным током характерна более слабая зависимость характеризующих его величин (To, xe, No) от силы разрядного тока І и полного числа частиц в разряде. Эти особенности предъявляют достаточно высокие требования к характеристикам экспериментальных установок для создания непрозрачного либо оптически серого разряда с обратным током.

Сделаем некоторые оценки. Будем исходить из необходимости создания обратного пинча с  $R_0 = 10$  см и температурой излучающей поверхности  $T=2\cdot 10^4$  К. Для того чтобы температура в разряде была однородной и можно было считать  $T\simeq T_0$ , ток I должен быть достаточно большим. Предположим, что  $I = 10^6$ ,  $A = 3 \cdot 10^{45}$  CGSE, что легко достижимо на современных генераторах импульсных токов, в частности, на описанной в [12] экспериментальной установке. Теперь для заданных I, Ro и T можно определить из (10) необходимое число частиц в разряде, полагая  $z \simeq 1$ , что дает  $N_{\rm m} \simeq 10^{20}$  см<sup>-1</sup>. Подставляя, далее, полученное значение N<sub>n</sub> в соотношения (13) и (14), легко убеждаемся, что для случая многократной ионизации выбранное значение I соответствует предельному току непрозрачного разряда. Заметим, что величина  $N_n = 10^{20}$  см<sup>-1</sup> может быть получена при испарении, например, серебряной фольги толщиной  $\sim 10^{-4}$  см. Технологически осуществить взрыв в вакууме столь тонкой фольги достаточно трудно, поэтому более удобно, по-видимому, создавать необходимый коаксиальный слой рабочего вещества либо взрывом нескольких проволочек, либо инжекцией в вакуум паров или порошка рабочето вещества, как это сделано, например, в [13]. Увеличивать же N<sub>n</sub> нецелесообразно, поскольку при этом для достижения прежнего значения температуры То придется увеличивать I и, кроме того, поскольку при этом режим разряда будет смещаться в сторону нижнего предельного тока, т. е. в сторону увеличения неоднородности температуры в разряде.

В заключение укажем, что анализ устойчивости серого разряда с обратным током проводится аналогично анализу устойчивости линейного серого разряда [9] и показывает, что серый разряд обладает такой же устойчивостью, как и непрозрачный. А это означает, что он подвержен развитию только силовых неустойчивостей, среди которых наиболее опасная длинноволновая мода перетяжечной неустойчивости имеет инкремент  $\gamma^{-1} \sim R_0 / v_s$ , где  $v_s$  — скорость звука. При указанных выше параметрах время жизни обратного разряда составит около 50 мкс.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Александров А. Ф., Рухадзе А. А. «Успехи физических наук», 105, вып. 4, 1971.
- 2. Александров А. Ф., Зосимов В. В. и др. Препринт, ФИАН, № 72, 1971. 3. Александров А. Ф., Зосимов В. В., Рухадзе А. А., Савоскин В. И., Тимофеев И. Б. III Всесоюзная конференция по физике низкотемператур-
- ной плазмы. Краткое содержание докладов. М., 1971. 4. Александров А. Ф., Зосимов В. В., Тимофеев И. Б. В кн.: Крат-кие сообщения по физике, 1972, № 2, с. 25.
- 5. Клементов А. Д., Михайлов Г. В. и др. «Теплофизика высоких тем-ператур», 8, № 4, 736, 1970.
- 6.-Николаев Ф. А., Розанов В. Б., Свириденко Ю. П. В кн.: Краткие сообщения по физике, 1971, № 4, с. 59.
- 7. Рухадзе А. А., Тригер С. А. «Прикладная математика и физика», № 3. **1**1, 1968.

В. Рухадзе А. А., Розанов В. Б., Тригер С. А. — «Прикладная математика и теорегическая физика», № 5, 18, 1968.
 Александров А. Ф., Каминская Е. П., Рухадзе А. А. «Прикладная математика и теоретическая физика», № 1, 33, 1971.
 Александров А. Ф., Решетняк С. А. — «Прикладная математика и теоре-тическая физика» № 2, 21, 1973.
 Пустовалов В. В., Розанов В. Б. Препринт, ФИАН, № 52, 1969.

Поступила в редакцию 24.7 1974 г.

Кафедра электроннки